

شرکت (دانش بنیان تولیدی)
توسعه فناوری ریز مقیاس آزینه



Mask Aligner
MAB-110365

دستگاه تطبیق ماسک مدل MAB-110365 دستگاه لیتوگرافی با استراکچر پیشرفته است که قابلیت تطبیق ماسک و نمونه، از بالا و پایین را دارا است.

❖ قابلیت تطبیق ماسک و نمونه با دقت ۲ تا ۴ میکرون | از بالا و پایین

❖ محدوده جابجایی نمونه، برای تطبیق بین ماسک و نمونه

$x, y : \pm 7,5 \text{ mm}$

$z : \pm 15 \text{ mm}$

❖ طراحی ویژه نگهدارنده نمونه با قابلیت استفاده برای ویفرهای با اندازه های از ۰,۵ تا ۴ اینچ

❖ سه صفحه نگهدارنده ماسک با ابعاد متفاوت جهت استفاده از ماسک های با ابعاد ۱، ۲ و ۴ اینچ

❖ نوردهی ماورابنفش با توان ۵۰ و ۱۰۰ وات

❖ استفاده از میکروسکوپ دیجیتال تا بزرگنمایی ۲۰۰ برای مشاهده سطح ماسک یا نمونه

❖ جابجایی قسمت اپتیک و موقعیت لنزها با جوی استیک

❖ سرعت جابجایی میکروسکوپ از $(1-5) \text{ mm/s}$ براساس میزان انحراف دسته جوی استیک

❖ امکان جابجایی دوربین های پشت نمونه در محدوده $40 * 40 \text{ mm}$

❖ قابلیت لیتوگرافی برای ماسک های تا ابعاد $100 * 100 \text{ mm}$

Technical data: AMS Mask Aligners

FEATURES		<u>MAB-110365</u>
Sample size (inch)		1-2-3-4 inch
Mask size (inch)		1-2-4
Exposure System	wavelength	350–375nm
	power	UV100
	Beam size	5 inch
Minimum Feature size		3 μ m
Alignment methods		Top-side (TSA) Back-side (BSA)
XY- alignment stage resolution		2 μ m
Alignment range	X	± 12.5
	Y	± 12.5
	Z	± 25
	θ	± 15 deg
Scanning movement XY(mm*mm)		80*80
TSA microscope stage (joystick)	Fullfield XY(mm*mm)	100*100
	Lens	2X
	scanning speed (Joystick)	1-5 mm/s
BSA microscope stage (micrometer)	Fullfield XY(mm*mm)	50*50
	Max Magn.	40X
Maximum Mask size (mm×mm)		100*100
Working distances		1-4 cm
Vacuum chunk for samples		1-2-3-4 inch
Mask and sample holding mechanism		Pneumatic-auto
Anti-vibration platform		Damping base
Digital Microscope		200X
Proximity Control		1 μ m resolution
PC and software		software, Controls, CD, Windows®

